

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	ผลของความดันก๊าซไนโตรเจนต่อสมบัติของฟิล์มไทเทเนียมไนไตรด์ ที่เตรียมด้วยเทคนิคการอาร์คของแคโทดในสุญญากาศสำหรับไบโพลาร์เพดในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
ผู้เขียน	นางสาวดารารรณ เพ็ชรช้าง
ปริญญา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ดร. มิณทร์ เมธิ์สุวกุล

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เคลือบผิวบนโลหะสแตนเลสสตีลชนิด 304 โดยใช้เทคนิคการอาร์คของโลหะในสุญญากาศ แคโทดทำจากแท่งไทเทเนียม การกำเนิดพลาสมาทำโดยการให้แรงดันไฟฟ้าขนาด 450 V ระหว่างขั้วแอโนดและแคโทดในบรรยากาศของไนโตรเจน ความดันของไนโตรเจนอยู่ในช่วงตั้งแต่  $10^{-5}$  to  $10^{-3}$  torr และให้ศักย์ไฟฟ้า -1 kV กับแท่นรับ จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้เคลือบผิว ได้แก่ โครงสร้างทางจุลภาคโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอน (XPS) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี โดยการจุ่มชิ้นงานในสารละลายกรดซัลฟูริก 1 M ที่อุณหภูมิ 25°C และทดสอบความต้านทานทางไฟฟ้าด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัส (ICR) ตามวิธีการของ Davies

ฟิล์มบางที่ผลิตได้มีความหนาแน่นและเรียบ มีความหนาประมาณ 35 – 62 nm เนื้อฟิล์มประกอบด้วย TiN, TiON และ TiO<sub>2</sub> ยกเว้นชิ้นงานที่สร้างภายใต้ความดันก๊าซไนโตรเจน  $5.0 \times 10^{-3}$  torr ที่มีเพียง TiON และ TiO<sub>2</sub> ค่า ICR ของชิ้นงานเคลือบผิวทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นงานไม่เคลือบผิว ชิ้นงานที่เคลือบผิวมีค่าความต้านทานการกัดกร่อนสูงกว่าแบบไม่เคลือบเนื่องมาจากการผลิตแพสซีฟฟิล์มหลังจากการทดสอบโพเทนติโอดินามิกส์ โพลาริเซชัน จากกราฟโพลาริเซชัน ณ ศักย์ -0.1 V กระแสไฟฟ้ามีค่าน้อยกว่าค่าที่ DOE กำหนด ในขณะที่ศักย์ 0.6 V มีค่ากระแสไฟฟ้าของทุกชิ้นงานที่เคลือบผิวสูงเกินกว่าค่าที่ DOE กำหนด เนื่องจากไม่สามารถ

สร้างเพชรฟิล์มให้เสถียรได้ ชั้นงานที่สร้างภายใต้ความดันก๊าซไนโตรเจน  $5.0 \times 10^{-4}$  torr เป็นชั้นงานที่ดีที่สุดเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับชั้นงานอื่นแล้วพบว่า มีความหนามากที่สุด มีค่าความต้านทานไฟฟ้าเชิงสัมผัสน้อยที่สุดและมีค่าความต้านทานการกัดกร่อนอยู่ในเกณฑ์ดี



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © by Chiang Mai University  
All rights reserved

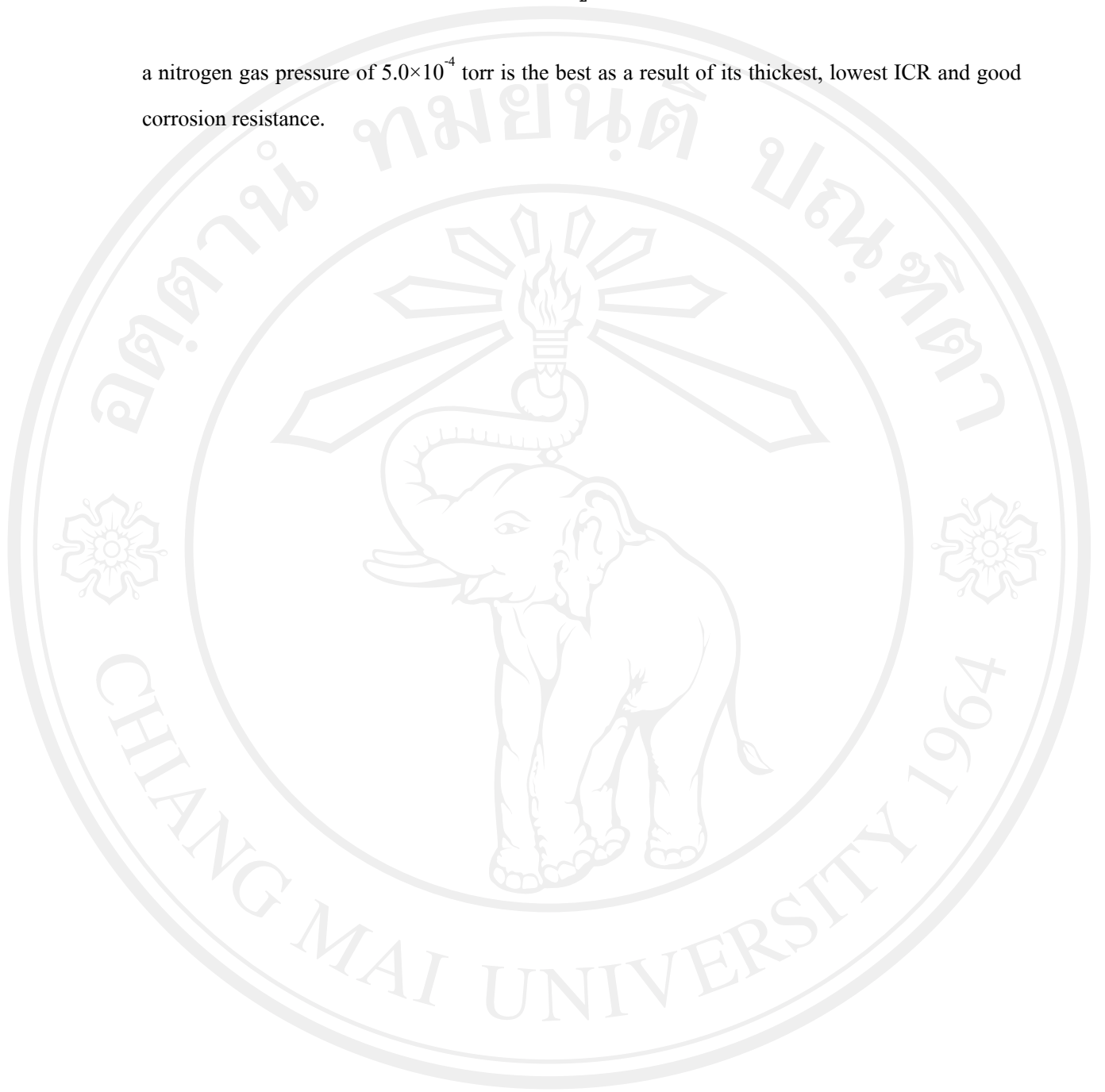
<b>Thesis Title</b>	Effects of N <sub>2</sub> Pressure on Properties of Titanium Nitride Films Prepared by Cathodic Vacuum Arc Technique for Bipolar Plates in Proton Exchange Membrane Fuel Cells
<b>Author</b>	Miss Darawan Pejchang
<b>Degree</b>	Master of Science (Applied Physics)
<b>Thesis Advisor</b>	Dr. Min Medhisuwakul

### ABSTRACT

This research is aimed to synthesize titanium nitride (TiN) thin films on stainless steel 304 using metal vacuum arc surface coating technique. A titanium rod is used as cathode. Plasma is generated by applying an arc pulse voltage of 450 V between the electrodes in N<sub>2</sub> atmosphere. The pressure of N<sub>2</sub> is varied from 10<sup>-5</sup> to 10<sup>-3</sup> torr. The bias voltage for substrate is -1 kV. Then the properties of the films are investigated and compared with the untreated substrate. The microstructure of TiN thin films is identified by X-ray photoelectron (XPS) and scanning electron microscopy (SEM). The corrosion resistance is examined by electrochemical test in 1 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> solution at 25°C. The electrical resistivity is analyzed by interfacial contact resistance (ICR) measurements by following the Davies method.

The TiN thin films are very dense and smooth. Their thickness is around 35 – 62 nm. The fabricated films contain TiN, TiON and TiO<sub>2</sub> species homogeneously except TiN6 specimen that has only TiON and TiO<sub>2</sub> content. The ICR of all coated specimens are increased compared with uncoated one. The coated surfaces have higher corrosion resistance than the uncoated one due to the formation of the passive films after potentiodynamics polarization. The current from polarization curve at -0.1 V is less than the DOE value, while the current at 0.6 V of all coated specimen exceed the DOE value because their passive films are not stable. The film coated under

a nitrogen gas pressure of  $5.0 \times 10^{-4}$  torr is the best as a result of its thickest, lowest ICR and good corrosion resistance.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved